(19) 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫ 公開特許公報 (A)

昭59—94256

DInt. Cl.3 G 11 B 11/10 5/62

G 11 C 13/06

識別記号

庁内整理番号 7426—5D 7350—5 D

7341—5B

昭和59年(1984)5月30日 43公開

発明の数 2 審查請求 未請求

(全 3 頁)

匈光磁気デイスクおよびその製造方法

②特

願 昭57—204073

②出

願 昭57(1982)11月19日

仰発 明 者 原憲明

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

工藤嘉彦 **⑫発** 明 者

門真市大字門真1006番地松下電

器産業株式会社内

⑪出 願 人 松下電器産業株式会社

門真市大字門真1006番地

個代 理 人 弁理士 中尾敏男

外1名

2 ページ

明 細

1、発明の名称

光磁気ディスクおよびその製造方法

2、特許請求の範囲

- (1) 低融点ガラスよりなる基板のトラッキング溝 側の表面に磁性薄膜を設けてなる光磁気ディスク。
- (2) あらかじめトラッキング溝に対応する凹凸溝 が形成されたポリイミド樹脂よりなるスタンパの 表面に溶融した低融点ガラスを流し込んで冷却し たのちにトラッキング溝付きの低融点ガラスより なる基板を上記スタンパから分離し、その後、上 記基板のトラッキング構側の表面に磁性薄膜を形 成することを特徴とする光磁気ディスクの製造方 法。
- (3) ポリイミド樹脂よりなるスタンパの凹凸溝の 表面に酸化ケイ素又は二酸化ケイ素の膜を設けた ことを特徴とする特許請求の範囲第2項記載の光 磁気ディスクの製造方法。
- 3、発明の詳細な説明

産業上の利用分野

本発明は光磁気ディスクおよびその製造方法に 関するものである。

従来例の構成とその問題点

一般に、光磁気ディスクは書き換え可能であり、 高密度,大容量,高速アクセスが可能なメモリ媒 体として広く研究されている。

その応用商品としては、オーディオディスク、 ビデオディスク,編集機用ディスク,文書ファイ ルディスク,静止画ファイルディスクと多方面に わたっている。

従来から光磁気ディスクは第1図に示すように ニッケルメッキを施したスタンパ3亿フォトポリ マーを流し込み、ガラス基板若しくはアクリル基 板2で押えた後に光を照射してフォトポリマーを 硬化させ、スタンパ3を剝離させることによって フォトポリマーでなる溝付き基板1を形成し、と の溝付き基板1の溝を有する面側に磁性薄膜とし ての希土類または鉄などの金属材料を真空蒸着。 スパッタリング等の手法によって成していた。し かし上述した光磁気ディスクでは帯付き基板1が

発明の目的

本発明の目的は、磁性薄膜を垂直に配向させや すく、かつ磁性薄膜の酸化が起りにくく経時変化 の少ない光磁気ディスクおよびその製造方法を提 供することにある。

発明の構成

5 4-3

内部に上記スタンパ11をセットするための支持台15、および炉内部を加熱するためのヒータ16を備えている。17は材料加熱炉で、内部に材料を入れるルツボ18、および炉内部を加熱するヒータ19を備えており、他に上記ルツボ18内の溶融材料を上記ディスク成形炉14に送り込むための送りパイプ20と、この送りパイプ20を開閉する開閉コック21と、上記送りパイプ20を加熱するヒータ22を備えている。

とこで、上記スタンパ11は熱硬化形ポリアミド酸溶液をメタルマザーに流入させた状態で200℃,2時間の条件でポリイミド樹脂を硬化させた後に上記メタルマザーかつ剝離し、その後450℃,2時間の条件で真空加熱してポリイミド樹脂の脱ガス処理を行ない、しかる後に表面に真空蒸着法によりSiO2を1μmの厚さで形成することにより作成した。

次に、上記ディスク成形炉を用いて光磁気ディスクを製造する方法について説明する。まず軟化点377℃の低融点ガラス25をルツポ18に入

本発明の光磁気ディスクは、低融点ガラスより なる基板のトラッキング帯側の表面に磁性薄膜を 設けたものである。

また、本発明の光磁気ディスクの製造方法は、 あらかじめトラッキング帯に対応する凹凸帯が形成されたボリイミwド樹脂よりなるスタンパの表面に溶融した低融点ガラスを流し込んで冷却したのちにトラッキング帯付きの低融点ガラスよりなる基板を上記スタンパから分離し、その後、上記基板のトラッキング帯側の表面に磁性薄膜を形成するようにしたものである。

実施例の説明

第2図は本発明の一実施例を示しており、図中 11はボリイミド樹脂よりなるスタンパであり、 その片面に第3図に示すようにトラッキング帯に 対応する凹凸溝12を有し、この凹凸溝12の表 面に二酸化ケイ素(SiO₂)の層13を有している。 このスタンパ11の凹凸溝12は光磁気ディスク が必要とするトラッキング帯と凹凸が相反する方 向で形成されている。14はディスク成形炉で、

6 _{ページ}

れて材料加熱炉17で480℃まで加熱して溶融 した後、開閉コック21を開いて溶融ガラスをヒ ータ付き送りパイプ20を経由してディスク成形 炉14にセットされた支持台15上のポリイミド 樹脂製スタンパ11の表面上流し込んだ。との場 合、ディスク成形炉14は予じめ450℃に加熱 しておく。そして、スタンパ11に流し込んだ榕 融ガラスの表面が平らになった後に徐冷し、完全 に冷却された後にポリイミド樹脂製のスタンパ11 を剝離するか、または2-アミノエタノールなど の溶剤を用いてポリイミド樹脂を溶かしてガラス 基板を得た。なお、ガラス基板の表面は酸化物な どの不純物が残るため表面を研磨して平坦な面と しておく。このようにして第4図に示すようにト ラッキング溝23を有するガラス基板24を得、 次に上記トラッキング溝23側の表面に磁性薄膜 26としての希土類または鉄などの金属材料を真 空蒸着,スパッタリング等の手法によって成形し た。

尚、上記の実施例ではポリイミド樹脂製のスタ

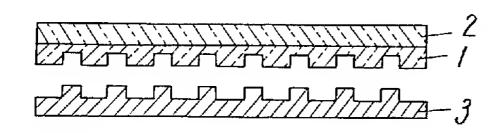
ンパ11の凹凸構12の表面に二酸化ケイ素の層13を設けたが、これ以外に一酸化ケイ素(SiO)の層であってもよい。このようにSiO,SiO2の層13をポリイミド樹脂製のスタンパ11の凹凸構12の表面に設けると、その凹凸構12のエッジをシャープにすることができ、ガラス基板24側のトラッキング溝23を正確に形成することができる。

発明の効果

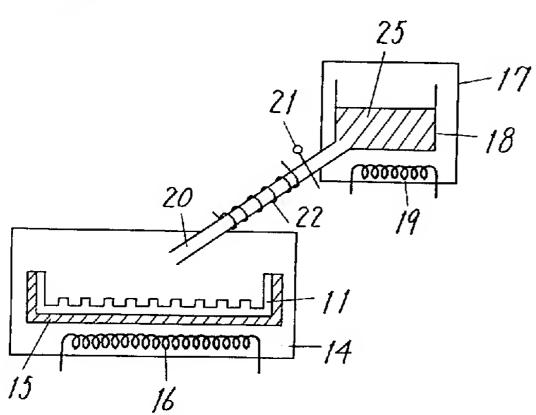
以上、詳述したように本発明によれば、低融点ガラスよりなる基板のトラッキング帯側の表面に磁性薄膜を設けたフォトボリマー基板のようにガス放出がなく、磁性薄膜における磁化が膜面に垂直に配向する垂直性が得られやすい利点があり、また、ガラス基板であるためフォトボリマー基板のように内部に水分,酸素,酸が含まれることに起因する磁性薄膜の酸化現象が起りにくく、経時変化を著しく少なくすることができる利点を有する。

4、図面の簡単な説明

第 1 図



第 2 図

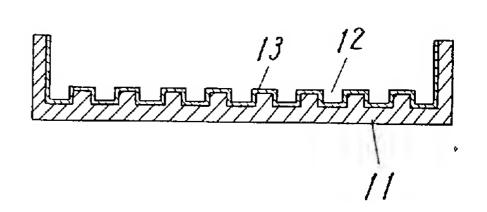


第1図は従来の光磁気ディスクの製造方法の説明図、第2図は本発明の光磁気ディスクの製造方法の一過程を示すプロック図、第3図は同法にて使用するスタンパの拡大断面図、第4図は同法にて得た光磁気ディスクの断面図である。

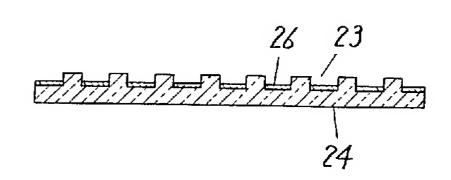
1 1 ······ スタンパ、1 2 ······ 凹凸溝、1 3 ······ S i O ₂層、1 4 ······ ディスク成形炉、1 7 ······ 材料加熱炉、2 3 ······ トラッキング溝、2 4 ······ ガラス基板、2 6 ······ 磁性薄膜。

代理人の氏名 弁理士 中 尾 敏 男 ほか1名

第 3 図



第 4 🗵



PAT-NO: JP359094256A

DOCUMENT- JP 59094256 A

IDENTIFIER:

TITLE: PHOTOMAGNETIC DISK

AND ITS PRODUCTION

PUBN-DATE: May 30, 1984

INVENTOR-INFORMATION:

NAME COUNTRY

HARA, NORIAKI

KUDO, YOSHIHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME COUNTRY

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO N/A LTD

APPL-NO: JP57204073

APPL-DATE: November 19, 1982

INT-CL (IPC): G11B011/10 , G11B005/62 , G11C013/06

US-CL-CURRENT: 148/121 , G9B/5.293

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a photomagnetic disk with which a magnetic thin film is easily oriented vertically with a reduced degree of oxidation and a small change with time, by separating a substrate made of a glass plate having a low melting point provided with tracking grooves from a stamper and then forming a magnetic thin film on the side surface of the tracking groove of said substrate.

CONSTITUTION: A disk forming oven 14 is heated previously up to 450°C and then cooled slowly after the surface of the molten glass poured into a stamper 11. Then the stamper 11 made of polyimide resin is separated after the oven 14 is completely cooled. Otherwise a solvent such as 2-aminoethanol is

used to dissolve the polyimide resin. Thus a glass substrate is obtained. In this case, the surface of the glass substrate is polished flatly because the impurities like an oxide, etc. remain there. Thus a glass substrate 24 having a tracking groove 23 is obtained as shown in the figure. Then a metallic material such as rare earth or iron, etc. is formed on the side surface of the groove 23 as a magnetic thin film 26 by a vacuum vapor deposition process, a sputtering process, etc.

COPYRIGHT: (C) 1984, JPO&Japio